10695788

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-261335 (P2001-261335A)

(43)公開日 平成13年9月26日(2001.9.26)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	,	7	-7J-ド(参考)
C 0 1 G 9	/08	C01G	9/08		4K017
B 2 2 F 1	/02	B 2 2 F	1/02.	В	4K018
9,	/28		9/28-	Z	

審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 8 頁)

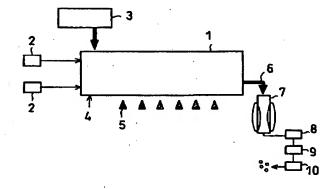
(21)出願番号 特願2000-77210(P2000-77210) (71)出願人 000003078 株式会社東芝 東京都港区芝浦一丁目1番1号 (72)発明者 松井 功 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (74)代理人 100081732			一种工机	木崎水 明水項の数6. OL (至 6 頁)
(22)出顧日 平成12年3月17日(2000.3.17) 東京都港区芝浦一丁目1番1号 (72)発明者 松井 功 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (74)代理人 100081732	(21)出願番号	特顧2000-77210(P2000-77210)	(71)出顧人	000003078
(72)発明者 松井 功 神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (74)代理人 100081732 弁理士 大胡 典夫 (外2名) Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EX04				株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (74)代理人 100081732 弁理士 大胡 典夫 (外2名) Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EX04	(22)出顧日	平成12年3月17日(2000.3,17)		東京都港区芝浦一丁目1番1号
神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株 式会社東芝研究開発センター内 (74)代理人 100081732 弁理士 大胡 典夫 (外2名) Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EX04	141		(72)発明者	松井 功
式会社東芝研究開発センター内 (74)代理人 100081732 弁理士 大胡 典夫 (外2名) Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EK04			,	
(74)代理人 100081732 弁理士 大胡 典夫 (外2名) Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EX04				
弁理士 大胡 典夫 (外2名) Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EX04		50 ₄	(7.4) (1) 794 1	
Fターム(参考) 4K017 AA01 BA09 EK04			(74)代理人	100081732
	• • •			弁理士 大胡 典夫 (外2名)
4K018 RA11 RR05 RC29 RD10			Fターム(参	考) 4K017 AA01 BA09 EK04
				4K018 RA11 RR05 RC29 RD10
		•		
		· ·		

(54) 【発明の名称】 粒子製造方法および粒子製造装置

(57) 【要約】

【課題】 本発明は反応容器内で生成された粒子の粒子成長と同時に進行する凝集による粒子の大粒子化を抑制する粒子製造装置および粒子製造方法の提供を目的とする。

【解決手段】 粒子製造装置は、反応容器1と、反応容器1に原料ガスを導入する原料ガス導入部2と、反応容器1に表面付着物を導入する表面付着物導入部3と、反応容器1にキャリアガスを導入する不活性ガス導入部4と、反応容器1に設けられるヒータ5と、排出部6と、排出部6を介して反応容器1から排出される生成された微粒子と不活性ガスが導入されるクーラ7と、クーラ7を通過した粒子を保存する保存部8と、保存部に貯蔵される粒子を含む溶媒から液体成分や表面付着物を取り除くヒータ9と、粒子径の異なる粒子の中から所望の大きさの粒子のみを抽出するフィルタ10とから構成される。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】複数の原料ガスを反応容器に導入し、前記 反応容器内で前記原料ガスを励起させることにより、前 記原料ガスを反応させて粒子を製造する粒子製造方法に おいて、

前記複数の原料ガスと、前記粒子表面に付着し、前記粒子を正または負のいずれかに帯電させる気体状の表面付着物とが、前記反応容器に導入される行程と、

前記反応容器内の前記原料ガスを励起することによって、前記反応容器内で前記原料ガスを反応させて前記粒 10子が生成されるとともに、前記粒子表面に前記表面付着物を付着させる行程と、

前記反応容器から前記粒子を取り出す行程とを有することを特徴とする粒子製造方法。

【請求項2】前記表面付着物は、界面活性剤であることを特徴とする請求項1に記載の粒子製造方法。

【請求項3】前記原料ガスと前記表面付着物とを混合し、混合された物質が前記反応容器に導入されることを特徴とする請求項1または2のいずれかに記載の粒子製造方法。

【請求項4】前記原料ガス、または前記表面付着物は、 溶媒に溶かされて霧状で前記反応容器に導入されること を特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の粒子製 造方法。

【請求項5】複数の原料ガスが導入される反応容器と、 前記反応容器内で前記原料ガスを励起させるための励起 手段とを有し、前記反応容器内で前記原料ガスから粒子 を生成する粒子製造装置において、

前記複数の原料ガスと、前記粒子表面に付着し、前記粒子を正または負のいずれかに帯電させる気体状の表面付 30 着物とが導入される反応容器と、

前記反応容器内の前記原料ガスを励起させて反応させる ための励起エネルギを発生させる励起手段と、

表面に前記表面付着物が付着した前記粒子を前記反応容*

 $Z n (NO_3) _2 + SC (NH_2) _2 \rightarrow Z n S + NO_2 + CO_2 + (NH_2) _2 \cdots (1)$

化学反応後、原料ガスは分解されて微粒子からなる新たな物質 Z n S と C d S とになる。これら生成物質は、反応容器 1 0 1 から不活性ガスと共に排出されてクーラ 1 0 3 に導かれ室温程度に冷却される。冷却された生成物質は、各生成物質の粒子が互いに凝集しないよう例えば脂肪酸塩などの界面活性剤溶液(液中のひとつひとつの分子中に親水基(水になじみやすい)と親油基(疎水基ともいい、油になじみやすい)をあわせもったもの)中に供給されて混合部 1 0 4 にて混合される。その後、界面活性剤溶液と混合された微粒子は、界面活性剤溶液に溶け込んだ状態で保存され、必要に応じて分級手段 1 0 5 により分級され、微粒子のみを得ている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述の 50 供を目的とする。

*器から回収する手段とを具備することを特徴とする粒子 製造装置。

【請求項6】前記表面付着物は、界面活性剤であることを特徴とする請求項5に記載の粒子製造装置。

【請求項7】前記原料ガスと前記表面付着物とを混合し、混合された物質が前記反応容器に導入されることを 特徴とする請求項5または6に記載の粒子製造装置。

【請求項8】前記原料ガス、または前記表面付着物は、 溶媒に溶かされて霧状で前記反応容器に導入されること を特徴とする請求項5乃至7に記載の粒子製造装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、粒子製造方法および粒子製造装置に係り、特に界面活性剤を用いて気相中で微粒子を生成する粒子製造方法および粒子製造装置に関する。

[0002]

【従来の技術】ナノメートルサイズの微粒子は量子サイ ズ効果など従来にない機能を有し、新しい形態の物質と して近年注目されつつある。このナノメートルサイズの 微粒子は、微粒子の種類によって、電池の電極や、可視 光LED素子やディスプレイの蛍光体などに応用されて いる。ここで、気相中で製造される微粒子の製造装置の 従来構成について図7を参照して説明する。OKUYA MAらによれば (J. Materials Scien ce, vol32, 1229-1237 (1997)) に記載されているように、複数の原料タンク100に貯 蔵される原料ガスZn(N〇3)2とCd(N〇3)2 とSC(NH2)2が、内部が窒素ガスなどの不活性ガ ス雰囲気である反応容器101に導入される。原料ガス が導入された反応容器101は、反応容器101に設け られるヒータ102によって600~700℃に加熱さ れ、原料ガスはヒータ102から熱エネルギを受け取り 例えば式(1)なる化学反応をおこす。

ような構成をした従来の粒子製造装置では、反応容器から取り出された後で、微粒子に界面活性剤溶液を吹き付けて、微粒子の凝集を抑制しているが、このような構成では、反応容器内および反応容器から混合部までの配管内で、生成された粒子径の小さい微粒子が凝集してしまう恐れがあった。特に、反応容器内では、原料ガスから粒子径の小さい微粒子の凝集がおこるため、微粒子の凝集を抑制することは困難であった。そこで、本発明は上記従来の問題点になみてなされたもので、微粒子が凝集することによって独身でなされたもので、微粒子が凝集することになる子径の大きな粒子となることを抑制し、原料ガスの利用効率を向上させる粒子製造方法および粒子製造装置の提供を目的とする

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するために、本発明の粒子製造装置は、複数の原料ガスが導入される反応容器と、前記反応容器内で前記原料ガスを励起させるための励起手段とを有し、前記反応容器内で前記原料ガスから粒子を生成する粒子製造装置において、前記複数の原料ガスと、前記粒子表面に付着し、前記粒子を正または負のいずれかに帯電させる気体状の表面付着物とが導入される反応容器と、前記反応容器内の前記原料ガスを励起させて反応させるための励起エネルギを10発生させる励起手段と、表面に前記表面付着物が付着した前記粒子を前記反応容器から回収する手段とから構成される。

【0005】また、本発明の粒子製造方法は、複数の原 料ガスを反応容器に導入し、前記反応容器内で前記原料 ガスを励起させることにより、前記原料ガスを反応させ て粒子を製造する粒子製造方法において、前記複数の原 料ガスと、前記粒子表面に付着し、前記粒子を正または 負のいずれかに帯電させる気体状の表面付着物とが、前 記反応容器に導入される行程と、前記反応容器内の前記 20 原料ガスを励起することによって、前記反応容器内で前 記原料ガスを反応させて前記粒子が生成されるととも に、前記粒子表面に前記表面付着物を付着させる行程 と、前記反応容器から前記粒子を取り出す行程とを有す ることを特徴とする。尚、表面付着物は、陰イオン性界 面活性剤(脂肪酸塩、アルキル硫酸、エステル塩、ポリ オキシエチレン、アルキルエーテル、硫酸エステル塩、 アルキルベンゼンスルフォン酸塩、アルキルナフタレン スルフォン酸塩、アルキルスルホコハク酸塩、アルキル ジフェニルエーテルジスルフォン酸塩、アルキル リン 30 酸塩、その他陰イオン性界面活性剤、ナフタレンスルフ ォン酸ホルマリン縮合物、特殊ポリカルボン酸型高分子 界面活性剤)、非イオン性界面活性剤(ポリオキシエチ レンアルキルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキル エーテル、ポリオキシエチレン誘導体、ソルピタン脂肪 酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エス テル、ポリオキシエチレンソルビトール脂肪酸エステ ル、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレン脂 肪酸エステル、ポリオキシエチレンアルキルアミン、ア ルキルアルカノールアミド、トリオクチルフォスフィン 40 オキサイド、ドデシルアミン、アルカンチオールなどの 長鎖アルキルを含む界面活性剤、その他非イオン性界面 活性剤)、陽イオン性 界面活性剤(アルキルアミン 塩、第四級アンモニウム塩、その他陽イオン性界面活性 剤)、両性 界面活性剤 (アルキルベタイン、アミンオ キサイド、その他両性界面活性剤) などの界面活性剤 や、他の表面修飾剤でもよい。

【0006】なお、反応容器内の温度を高くすれば、生成速度は早くなるが生成物が凝集、粒子成長する割合が高くなり、逆に温度を低くすれば、生成速度は遅くなる 50

4

が凝集、粒子成長が起こる割合が低くなり粒子径を小さくできる。同様に、圧力が高い場合も、生成速度は早くなるが生成物が凝集、粒子成長する割合が高くなり、逆に圧力を低くすれば、生成速度は遅くなるが凝集、粒子成長が起こる割合が低くなり粒子径を小さくできる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態の構成 を図面を参照しながら説明する。

【0008】図1は本発明の粒子製造装置の第1の実施の形態の構成図であり、粒子製造装置は、反応容器1と、反応容器1に原料ガスを導入する原料ガス導入部2と、反応容器1に表面付着物を導入する表面付着物導入部3と、反応容器1にキャリアガスとして窒素などの不活性ガスを導入する不活性ガス導入部4と、反応容器1の外壁に設けられる励起手段なるヒータ5と、原料ガス導入部2が設けられた面と対向する面に設けられた排出部6と、排出部6を介して反応容器1から排出される生成された微粒子と不活性ガスが導入されるクーラ7と、クーラ7を通過した粒子を保存する保存部8と、保存部に貯蔵される粒子を含む溶媒から液体成分や表面付着物を取り除くヒータ9と、粒子径の異なる粒子の中から所望の大きさの粒子のみを抽出するフィルタ10とから構成される。

【0009】原料ガスは、2n (CH3) 2とH2Sであり、表面付着物はトリオクチルフォスフィンオキサイド(蒸気)である。また、原料ガス、表面付着物、キャリアガスはそれぞれ専用のタンク(図示しない)に貯蔵されている。また、フィルタ10の後には、フィルタ10を通過してきた粒子を貯蔵する容器(図示しない)が設けられている。

【0010】尚、ヒータ6は、反応容器1内を化学反応がおこる任意の温度に加熱し保持するために反応容器1の外壁に設けられるが、好ましくは反応容器1の中央部近傍の外壁にのみ設けることが好ましい。これは、原料ガス導入部2、表面付着物導入部3、不活性ガス導入部4の反応容器1の入口付近で化学反応がおこると、各導入部の入口付近に反応生成物が付着し入口を塞ぐ可能性があるためである。また生成された粒子が必要以上の大きさになるような粒子成長をさせないためでもある。

【0011】また、保存部8は、内部に水もしくはエタノールもしくはメタノールなどの溶媒が溜められており、この溶媒中にキャリアガスが吹き込むように導入される。

【0012】このような構成からなる第1の実施の形態の粒子製造方法について説明する。

【0013】(1)不活性ガスを不活性ガス導入部4から反応容器1に導入し、反応容器1から排出部6、クーラ7、保存部8、ヒータ9、フィルタ10へと流れる気流をつくる。

【0014】(2)ヒータ5により反応容器1内の温度

を600~700℃になるよう加熱する。このとき、反 応容器1内の気圧は760torrとし、クーラ7内の 温度は室温程度、気圧は760torrと設定する。

【0015】(3)複数の原料ガスが原料ガス導入部2 から反応容器1に導入される。原料ガスの導入とほぼ同 時に、表面付着物が表面付着物導入部3から反応容器1*

生成された ZnS (結晶) 粒子の平均粒子径は10 nm 程度である。

【0018】この生成された2nS粒子表面には、トリ 10 オクチルフォスフィンオキサイドが付着し、2nS粒子 の表面をトリオクチルフォスフィンオキサイドが被覆す るような状態となる。このとき表面がトリオクチルフォ スフィンオキサイドで被覆された2nS粒子は、負に帯 電しているため、クーロン力によって反発しあい2nS 粒子同士は結合して凝集することがない。

【0019】また、反応容器1内では、キャリアガスの 流れによって、原料ガス、表面付着物、ZnSやCH4 などの生成物が各導入部からクーラ6方向に移動されて いる。このキャリアガスの流れ方向の上流側の反応領域 20 で生成されるZnSの粒子径は、下流側の反応領域のZ nSの粒子径に比べて小さい。これは、反応領域の上流 側で生成されたZnSが反応領域を通過する間に、凝集 によって粒子径が大きくなるのではなく、粒子本体が粒 子成長するためである。

【0020】キャリアガスの流れにのって、数nmの粒 子径を持った Zn S粒子が、排出部 6 に流れ、反応容器 1から排出される。

【0021】(5)反応容器1から排出された2nS粒 子を含むキャリアガスは数100度であるため、クーラ 30 7に導入されて、室温程度にまで冷却される。

【0022】(6)冷却された粒子を含んだキャリアガ スは、保存部8内部に溜められている溶媒中に導入され る。溶媒を通過する際に、溶媒中にZnS粒子は溶け込 み、キャリアガスだけが保存部8外部の大気中に放出さ れる。

【0023】(7) ZnS粒子は、溶媒中に溶け込んだ 状態で保存される。ここで、ZnS粒子が必要な場合に は、保存部8から溶媒を所望量汲み出して、溶媒をヒー タ9により加熱し、溶媒成分を蒸発させて溶質となる2 40 nS粒子のみを析出させる。

【0024】(8) 析出された Zn S粒子は、排出部 6 を通過する間やクーラ7で冷却されるまでの間に粒子成 長により粒子径が大きくなり10nm以上になる場合も あり、粒子径の異なる粒子の集合体となっている場合に は、この異なる粒子径が存在する粒子の集合体から所望 の例えば10nm以下の粒子径の粒子を取り出すために フィルタ10を通過させて選別すればよい(分級)。

【0025】選別された粒子径は、電極、蛍光体などの 材料として使用される。

*に導入される。

【0016】(4)反応容器1内で、以下に示す式 (2) の熱分解反応である化学反応がおこる。なお、化 学反応はヒータ5によって600~700℃に加熱され

た領域(以下、反応領域と呼ぶ)でおこる。

[0017]

Zn (CH₃)₂+H₂S→ZnS (固体) + 2CH₄ (気体) ··· (2)

【0026】ここで、図2の粒子径と粒子径分布との関 係を表す図を参照して効果を説明する。

【0027】なお、圧力条件は10~760torrで あり、温度は100~1000℃で実験を行っている。 【0028】従来の技術による粒子径と粒子径分布は、 X軸と線しとで囲まれた領域であり、数nmの粒子径の

みを生成することは困難であったことがわかる(粒子径 が10 nm以下の粒子は全体の10%程度)。これは先 に述べたとおり、粒子の粒子成長と、生成された粒子の 凝集により粒子径が大きくなっているためである。尚、 粒子径が大きくなる原因は、凝集によるものの方が粒子 成長よりも大部分を占めていることが知られている。

【0029】これに対し、本発明の粒子径と粒子径分布 は、X軸と線Mとで囲まれた領域であり、数nm程度の 直径を有する微粒子が集中的に得られていることがわか る(粒子径が10nm以下のものは全体の90%以 上)。

【0030】通常、粒子の粒子径が小さければ小さいほ ど、例えばこの数nmの粒子径を有する粒子を電極に使 った場合では、発電効率が向上し、またLEDなどの発 光素子に使った場合には、発光効率が向上する。よっ て、発電もしくは発光効率を向上させる粒子を製造する ことができる。

【0031】以上述べたような第1の実施の形態では、 微粒子が凝集することによって粒子径の大きな粒子とな ることを表面付着剤を反応容器1に導入することによっ て抑制し、原料ガスの利用効率を向上させることができ る。

【0032】次に、本発明の粒子製造装置の第2の実施 の形態の構成について図3を参照して説明する。

【0033】尚、以下の各実施の形態において、第1の 実施の形態と同一構成要素は同一符号を付し、重複する 説明は省略する。

【0034】第2の実施の形態の特徴は、原料ガス、表 面付着物以外に溶媒を反応容器1に導入し、かつ反応容 器1に導入する際に静電噴霧器11により噴霧状にして 導入したことである。

【0035】図3(a)は、本発明の第2の実施の形態 の概略構成図であり、溶媒が貯蔵されるタンク(図示し ない)から溶媒導入部12を通って静電噴霧器11に到 達する。

【0036】溶媒は水、エタノール、メタノールまたは 50 それらが混合されたものであり、また原料ガスは2n

(NO3) 2とSC (NH2) 2であり、表面付着物は トリオクチルフォスフィンオキサイドである。

【0037】図3(b)は、静電噴霧器11の概略構成 図であり、静電噴霧器11は、帯電金属粒子やイオンの 発生装置 (J. F. Mahoney等, J. Appl. Phys., 40 (1996) 192) として使用され るものであり、反応容器1に接続される溶媒導入部12 外周部に一対の電極13が設けられた構造である。

【0038】このような構成からなる第2の実施の形態 について説明する。

【0039】(1)不活性ガスを不活性ガス導入部4か ら反応容器1に導入し、反応容器1から排出部6、クー ラ7、保存部8、ヒータ9、フィルタ10へと流れる気 流をつくる。

【0040】(2)ヒータ5により反応容器1内の温度*

Zn(NO₃)₂+SC(NH₂)₂→ZnS(固体)+NO₂(気体)+C O2(気体)+(NH2)2(気体)…(3)

生成された2nS(結晶)粒子の平均粒子径は、溶媒に エタノールを用いた場合には20nm程度である。

【0044】この生成されたZnS粒子表面には、トリ 20 オクチルフォスフィンオキサイドが付着し、ZnS粒子 の表面をトリオクチルフォスフィンオキサイドが被覆す るような状態となる。このとき表面がトリオクチルフォ スフィンオキサイドで被覆された乙nS粒子は、負に帯 電しているため、クーロン力によって反発しあいZnS 粒子同士は結合して凝集することがない。

【0045】また、反応容器1内では、キャリアガスの 流れによって、原料ガス、表面付着物、ZnSやN O2、CO2や(NH2) 2などの生成物が各導入部か らクーラ6方向に移動されている。このキャリアガスの 30 流れ方向の上流側の反応領域で生成される2nSの粒子 径は、下流側の反応領域のZnSの粒子径に比べて小さ い。これは、反応領域の上流側で生成されたZnSが反 応領域を通過する間に、凝集によって粒子径が大きくな るのではなく、粒子本体が粒子成長するためである。

【0046】キャリアガスの流れにのって、数nmの粒 子径を持った2nS粒子が、排出部6に流れ、反応容器 1から排出される。

【0047】(5)反応容器1から排出された2nS粒 子を含むキャリアガスは数100度であるため、クーラ 40 7に導入されて、室温程度にまで冷却される。

【0048】(6)冷却された粒子を含んだキャリアガ スは、保存部8内部に溜められている溶媒中に導入され る。溶媒を通過する際に、溶媒中に2nS粒子は溶け込 み、キャリアガスだけが保存部8外部の大気中に放出さ れる。

【0049】(7) ZnS粒子は、溶媒中に溶け込んだ 状態で保存される。ここで、ZnS粒子が必要な場合に は、保存部8から溶媒を所望量汲み出して、溶媒をヒー タ9により加熱し、溶媒成分を蒸発させて溶質となる 2 50

*を600~700℃になるよう加熱する。このとき、反 応容器1内の気圧は760torrとし、クーラ7内の 温度は室温程度、気圧は760torrと設定する。

【0041】(3)複数の原料ガスが原料ガス導入部2 から反応容器1に導入される。原料ガスの導入とほぼ同 時に、表面付着物が表面付着物導入部3から反応容器1 に導入される。原料ガスの導入とほぼ同時に、溶媒が静 電噴霧器11により噴霧状にされて(粒子径は数10n m程度) 反応容器1に導入される。

【0042】(4)反応容器1内で、溶媒を介して以下 に示す式(3)の熱分解反応である化学反応がおこる。 なお、化学反応はヒータ5によって600~700℃に 加熱された領域(以下、反応領域と呼ぶ)でおこる。

[0043]

nS粒子のみを析出させる。

【0050】(8)析出された2nS粒子は、排出部6 を通過する間やクーラ7で冷却されるまでの間に粒子成 長により粒子径が大きくなり10nm以上になる場合も あり、粒子径の異なる粒子の集合体となっている場合に は、この異なる粒子径が存在する粒子の集合体から所望 の例えば10 nm以下の粒子径の粒子を取り出すために フィルタ10を通過させて選別すればよい(分級)。

【0051】選別された粒子径は、電極、蛍光体などの 材料として使用される。

【0052】なお、原料ガスを反応容器1に導入する前 に、あらかじめ溶媒と混合させて混合液とし、その混合 液を反応容器1に噴霧状にして導入してもよい。

【0053】以上述べたような第2の実施の形態では、 微粒子が凝集することによって粒子径の大きな粒子とな ることを表面付着剤を反応容器1に導入することによっ て抑制し、原料ガスの利用効率を向上させることができ

【0054】また、溶媒を噴霧状にして反応容器1に導 入することにより、原料ガスは噴霧状の溶媒に取り込ま れて化学反応をおこすため、ZnS粒子の生成効率を増 加させることができる。また、溶媒に表面付着物が付着 しやすくなり、ZnS粒子の凝集をさらに抑制すること ができる。ここで、反応領域を通過する際に溶媒は蒸発 されて徐々にZnS粒子から取り除かれる。

【0055】次に、本発明の粒子製造装置の第3の実施 の形態の構成、動作について、図4を参照して説明す

【0056】第3の実施の形態の特徴は、励起手段を放 電手段14として反応容器1の外壁に設けたことであ

【0057】図4は、本発明の粒子製造方法の第3の実 施の形態の概略構成図であり、放電手段14は導線を反

応容器1の外壁に巻回し、導線の両端に電極(図示しない)を接続して構成される。

【0058】反応容器1内へ導入された原料ガスの励起は、放電手段14に電圧が印加され、放電手段14によって生成される数百k~数M [H2] の高周波が原料ガスに伝播することによって行われる。この高周波が原料ガスに伝播することによって、原料ガスの分解と粒子化反応が促進される。

【0059】尚、原料ガスの励起を行う行程以外は、原料ガス、表面付着物、キャリアガスも含めて第1の実施 10の形態もしくは第2の実施の形態と同一である。また、原料ガスを溶媒と混合させて静電噴霧器を用いて霧状にして反応容器1に導入することもできる。

【0060】以上述べたような第3の実施の形態では、 微粒子が凝集することによって粒子径の大きな粒子とな ることを表面付着剤を反応容器1に導入することによっ て抑制し、原料ガスの利用効率を向上させることができ る。

【0061】また、励起手段が放電手段14であるため、熱を加えることによって原料ガスを励起させる手段 20よりも消費電力を少なくすることができる。

【0062】次に、本発明の粒子製造装置の第4の実施の形態の構成、動作について、図5を参照して説明する。

【0063】第4の実施の形態では、励起手段としてヒータ5と放電手段14とを反応容器1に設けたことである。

【0064】図5は本発明の粒子製造装置の第4の実施の形態の概略構成図であり、反応容器1の外壁に、ヒータ5と放電手段14とを設け、ヒータ5と放電手段1430とにより原料ガスを励起させて、反応容器1内に導入された原料ガスの分解反応と粒子化反応とを行う。

【0065】尚、原料ガスの励起を行う行程以外は、原料ガス、表面付着物、キャリアガスも含めて第1の実施の形態もしくは第2の実施の形態と同一である。また、原料ガスを溶媒と混合させて静電噴霧器を用いて霧状にして反応容器1に導入することもできる。

【0066】以上述べたような第4の実施の形態では、 微粒子が凝集することによって粒子径の大きな粒子とな ることを表面付着剤を反応容器1に導入することによっ 40 て抑制し、原料ガスの利用効率を向上させることができ る。

【0067】また、ヒータ5の熱では化学反応がおこっても生成される粒子の結晶化が進みにくい原料ガスである場合、もしくは放電手段14による高周波では化学反応がおこっても生成される粒子の結晶化が進みにくい原料ガスである場合には、いずれかの励起手段によって化学反応がおこり、粒子の結晶化を促進させることができるため、原料ガスの利用効率を向上させることができる。

10

【0068】次に、本発明の粒子製造装置の第5の実施の形態の構成、動作について、図6を参照して説明する。

【0069】第5の実施の形態の特徴は、表面付着物導入部3a、3b、3cが反応容器1に接続される位置を 異ならせて設けたことである。

【0070】原料ガスから生成される粒子の粒子径を調 整するために、キャリアガスの流れ方向に、表面付着物 導入部3a、3b、3cが、反応容器1の外壁に設けら れる。表面付着物が貯蔵されるタンクと各導入部の間に は、パルプ15a、15b、15cが設けられる。原料 ガスから生成される粒子の粒子径が数nm程度のものを 製造する場合には、パルプ15aを開放(パルプ15 b、15cは共に閉)して、表面付着物導入部3aから のみ表面付着物を反応容器1内へ導入する。また、粒子 径が数10nm程度のものを製造する場合には、バルブ 15cを開放(パルプ15a、15cは共に閉)して、 表面付着物導入部3cからのみ表面付着物を反応容器1 内へ導入する。尚、所望の粒子径を製造するために、各 バルブを複数個同時に開放することもでき、また複数の バルブを開放した状態でも反応容器1内へ供給する流量 を各バルブで変えて供給することもできる。

【0071】尚、製造工程は、原料ガス、表面付着物、キャリアガスの種類も含めて第1乃至第4の実施の形態と同一である。また、原料ガスを溶媒と混合させて静電噴霧器を用いて霧状にして反応容器1に導入することもできる。

【0072】以上述べたような第5の実施の形態では、 微粒子が凝集することによって粒子径の大きな粒子となることを表面付着剤を反応容器1に導入することによって抑制し、原料ガスの利用効率を向上させることができる。また、反応容器1内に導入する表面付着物の導入部を適宜設定することによって、所望の粒子径を有した粒子を得ることができる。なお、本発明は上述した実施の形態には限定されず、主旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できることは言うまでもない。例えば、原料ガスを励起する手段として、光照射手段、例えば紫外線ランプを反応容器内もしくは外に設け、紫外線ランプからの光を原料ガスに照射することによって励起させ化学反応をおこすことも可能である。

[0073]

【発明の効果】以上述べたような本発明によれば、生成された粒子の凝集によって粒子径が大きくなることを抑制できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の粒子製造装置の第1の実施の形態の 概略構成図。

【図2】 粒子径と粒子径分布との関係を表すグラフ。

【図3】 本発明の粒子製造装置の第2の実施の形態の 概略構成図。

12

11

【図4】 本発明の粒子製造装置の第3の実施の形態の 概略構成図。

【図5】 本発明の粒子製造装置の第4の実施の形態の 概略構成図。

【図6】 本発明の粒子製造装置の第5の実施の形態の 概略構成図。

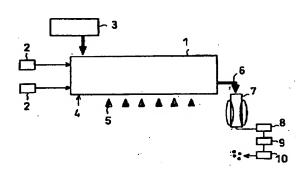
【図7】 従来の粒子製造装置の概略構成図。【符号の説明】

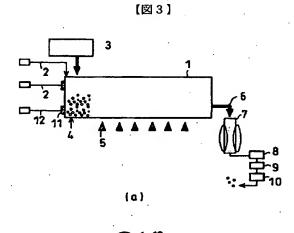
- 1 反応容器
- 2 原料ガス導入部
- 3 表面付着物導入部
- 4 キャリアガス導入部

*5 ヒータ

- 6 排出部
- 7 クーラ
- 8 保存部
- 9 ヒータ
- 10 フィルタ
- 11 静電噴霧器
- 12 溶媒導入部
- 13 電極
- 10 14 放電手段
 - 15a、15b、15c パルブ

【図1】

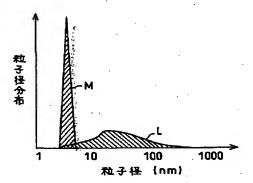




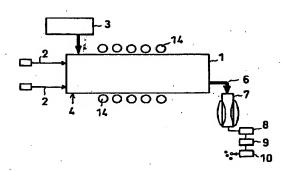
11--

(b)

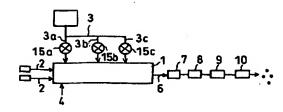
【図2】



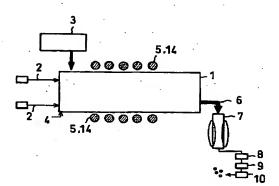
【図4】



【図6】



【図5】



【図7】

